

Проникновение пробного поля в греющуюся плазму

© К.Н. Овчинников, С.А. Урюпин[¶]

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН,
119991 Москва, Россия
[¶] e-mail: uryupin@sci.lebedev.ru

(Поступило в Редакцию 6 июля 2016 г. В окончательной редакции 12 октября 2016 г.)

Найдены явные зависимости эффективной глубины проникновения поля пробного импульса в токонесущую плазму с изменяющимися во времени температурами частиц. Показано, что проникновение поля в полностью ионизованную плазму происходит в режиме субдиффузии, а в слабоионизованную — в режиме сверхдиффузии.

DOI: 10.21883/JTF.2017.06.44505.1971

Введение

Импульсы электромагнитного поля используются для диагностики токонесущей плазмы и ее дополнительного нагрева. Для выбора оптимальных условий диагностики и нагрева нужно знать закономерности проникновения импульса в ограниченную плазму. Прежде всего эти закономерности зависят от того, какой механизм рассеяния электронов доминирует во время воздействия импульса. В плазме с большой плотностью тока, когда дрейфовая скорость электронов превосходит фазовую скорость ионно-звуковых волн, основной причиной рассеяния электронов являются флуктуации плотности заряда в поле ионно-звуковых волн [1–3]. Особенности проникновения монохроматического поля в турбулентную плазму исследованы в работах [4–7]. Изучению проникновения квазистационарного сильного и слабого полей в плазму с развитой ионно-звуковой турбулентностью посвящены работы [8,9]. При этом в [9] показано, что закономерности проникновения слабого импульса в значительной мере зависят от соотношения его длительности и характерного времени изменения температур частиц, а также от направления слабого поля относительно греющего плазму поля. Следует отметить, что в экспериментах встречаются и такие условия, когда дрейфовая скорость электронов сравнима со скоростью ионного звука (см., например, [10]) или меньше ее. В последнем случае доминирующим механизмом рассеяния электронов являются их столкновения с ионами. При еще меньших плотностях тока газ лишь частично ионизован и возможны условия, в которых доминируют столкновения электронов с нейтральными частицами. Несмотря на то что разряды с небольшой плотностью тока используются многие годы, задача об особенностях воздействия слабых пробных импульсов на такие разряды, по-видимому, не ставилась. Вместе с тем такая задача представляет определенный интерес не только сама по себе, но и в связи с необходимостью сопоставления особенностей взаимодействия слабых импульсов с ламинарной и турбулентной плазмами.

В настоящем сообщении изучено проникновение слабого импульса в токонесущую плазму с изменяющимися во времени температурами частиц. Для полностью ионизованной и слабоионизованной плазм установлены явные зависимости эффективной глубины проникновения поля от времени, параметров плазмы и импульса. Показано, что в случае полностью ионизованной плазмы проникновение поля длинного импульса происходит в режиме субдиффузии, когда эффективная глубина проникновения зависит от времени как $t^{1/5}$. В слабоионизованной плазме, в которой доминирует упругое рассеяние электронов на нейтральных частицах, глубина проникновения поля пропорциональна t , что позволяет говорить о сверхдиффузии поля. Отметим, что выявленные закономерности проникновения отличаются от закона, установленного ранее для турбулентной плазмы, в которой глубина проникновения возрастает пропорционально $t^{1/4}$ [9]. Иными являются и явные зависимости глубины проникновения от параметров плазмы, что позволяет выбирать оптимальные условия не только диагностики токонесущей плазмы, но и ее дополнительного нагрева.

1. Эволюция температур частиц

Пусть плазма занимает полупространство $x > 0$. Примем, что в плазме имеется однородное электрическое поле вида $\mathbf{E} = (0, 0, E)$, которое создает зависящий от времени электрический ток, плотность которого $\mathbf{j} = (0, 0, j)$. Однородный ток связан с полем соотношением

$$4\pi j + \frac{\partial}{\partial t} E = \text{const.} \quad (1)$$

Как правило, в плазме ток смещения мал по сравнению с током проводимости, и им можно пренебречь. При этом вместо уравнения (1) приближенно имеем $j \sim \text{const}$. Явный вид зависимости тока от электрического поля определяется материальными уравнениями. Ниже рассмотрены полностью ионизованная и слабоионизованная плазмы. Закономерности диссипативных процессов в плазме с током зависят от величины токовой скорости

электронов u , которая связана с плотностью тока соотношением

$$u = j/en_e, \quad (2)$$

где e и n_e — заряд и плотность электронов. В дальнейшем будем рассматривать условия, в которых токовая скорость электронов меньше скорости ионного звука $u < v_s$.

1.1. Полностью ионизованная плазма

В однородной плазме эволюция температур электронов T_e и ионов T_i описывается уравнениями

$$\frac{dT_e}{dt} = \frac{2jE}{3n_e\alpha} - v_e(T_e - T_i), \quad (3)$$

$$\frac{dT_i}{dt} = v_e Z(T_e - T_i). \quad (4)$$

В этих уравнениях $j = \sigma E$ — плотность тока, α — постоянная Больцмана,

$$\sigma = 32e^2 n_e / (3\pi m_e v_{ei}) \quad (5)$$

— проводимость плазмы, а эффективные частоты столкновений имеют вид

$$v_e = \frac{2m_e}{m_i} v_{ei}, \quad v_{ei} = \frac{4\sqrt{2\pi}}{3} \frac{e^2 e_i^2 n_i \Lambda}{m_e^2 v_{Te}^3}, \quad (6)$$

где v_{ei} — частота электрон-ионных столкновений, $v_{Te} = \sqrt{\alpha T_e / m_e}$ — тепловая скорость электронов, Λ — кулоновский логарифм, $Z = |e_i/e|$, а m_e и m_i — массы электрона и иона, e_i и n_i — заряд и плотность ионов. Первое слагаемое в правой части уравнения (3) описывает джоулев нагрев, второе — передачу энергии от электронов к ионам. Примем, что в начальный момент времени температуры электронов и ионов одинаковы $T_i = T_e = T_0$.

Тогда, когда $j = \text{const}$, система уравнений (3), (4) для температур принимает вид

$$\frac{dT_e}{dT_i} = (T_0/T_e)^{3/2} [aT_0 - (T_e - T_i)], \quad (7)$$

$$\frac{dT_i}{dT_i} = Z(T_0/T_e)^{3/2} (T_e - T_i). \quad (8)$$

При написании уравнений (7) и (8) использованы обозначения

$$\tau_i = v_e(0)t, \quad (9)$$

где $v_e(0)$ — частота релаксации температур в начальный момент времени и

$$a = \frac{\pi}{32} \frac{m_i}{m_e} \left[\frac{u}{v_{T_0}} \right]^2 = \frac{\pi Z}{32} \left[\frac{u}{v_s(0)} \right]^2 \ll 1, \quad (10)$$

где $v_{T_0} = \sqrt{\alpha T_0 / m_e}$, $v_s(0) = \sqrt{Z\alpha T_0 / m_i}$. Вводя переменную Ω , согласно соотношению $d\Omega/d\tau_i = (T_0/T_e)^{3/2}$, из системы уравнений (7) и (8) находим

$$ZT_e + T_i = aZT_0\Omega + (1+Z)T_0, \quad (11)$$

$$T_e - T_i = \frac{aT_0}{1+Z} \{1 - \exp[-(1+Z)\Omega]\}. \quad (12)$$

По определению, функция Ω монотонно возрастает со временем. В частности, при $(1+Z)\Omega \ll 1$ из (11), (12) имеем $T_e \sim T_0(1+a\Omega)$ и $T_i \sim T_0$. Если же $(1+Z)\Omega \gg 1$, то

$$T_e - T_i \approx \frac{aT_0}{1+Z}, \quad (13)$$

$$T_e \approx T_0 \left(1 + \frac{Z}{1+Z} a\Omega \right). \quad (14)$$

Из соотношений (10)–(14) видно, что температура электронов остается близкой к исходной T_0 , если $a\Omega \ll 1$. Это означает, что при $(1+Z)\Omega \ll 1$ отличим Ω и τ_i можно пренебречь. Далее, используя соотношение (13) и факт близости температуры T_e к T_0 в момент, когда $(1+Z)\tau_i \sim 1$, из уравнения (7) приближенно находим

$$T_e \approx T_0 \left[1 + \frac{5Za\tau_i}{2(1+Z)} \right]^{2/5}. \quad (15)$$

При $(1+Z)\tau_i \gtrsim 1$ температура ионов увеличивается по такому же закону, оставаясь меньше T_e на малую величину $aT_0/(1+Z)$ (см. (13)). Существенное увеличение температур начинается с момента

$$\tau_i \approx \frac{2(1+Z)}{5Za} \gg \frac{1}{1+Z} \quad (16)$$

или в явном виде при

$$\begin{aligned} t \gtrsim t_T &\equiv \frac{32}{5\pi} \frac{1+Z}{Z} \left[\frac{v_{T_0}}{u} \right]^2 \frac{1}{v_{ei}(0)} \\ &= \frac{64}{5\pi} \frac{1+Z}{Z^2} \left[\frac{v_s(0)}{u} \right]^2 \frac{1}{v_e(0)} \gg \frac{1}{v_e(0)}, \end{aligned} \quad (17)$$

где t_T — характерное время нагрева электронов и ионов, $v_{ei}(0)$ — частота столкновений электронов с ионами при $T_e = T_0$.

1.2. Слабоионизованная плазма

В слабоионизованной плазме рассеяние электронов в основном происходит на нейтральных частицах. Для частоты упругих столкновений электронов с тяжелыми нейтральными частицами используем простейшее выражение $v_{en}(v) = N\Sigma v$, где N — плотность нейтральных частиц, а Σ — не зависящее от скорости электрона сечение рассеяния. Тогда для проводимости имеем

$$\sigma = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{e^2 n_e}{m_e v_{en}}, \quad (18)$$

где $v_{en} = v_{en}(v_{Te})$. Используя приведенное в [11] (см. формулы (2.5) на стр. 215, (2.11) на стр. 218, (2.13) на стр. 219) кинетическое уравнение для изотропной части

функции распределения электронов и считая распределение электронов близким к максвелловскому, запишем уравнение для температуры электронов

$$\frac{dT_e}{dt} = \frac{2jE}{3n_e x} - \nu_{en}(T_e - T), \quad (19)$$

где использовано обозначение

$$\nu_{en} = \frac{16}{3\sqrt{2\pi}} \frac{2m_e}{M} \nu_{en}. \quad (20)$$

Здесь M — масса нейтральной частицы. При этом для T — температуры нейтральных частиц имеем

$$\frac{dT}{dt} = \nu_{en}(T_e - T). \quad (21)$$

В условиях, когда $j = \text{const}$, представим уравнения (19), (21) в виде

$$\frac{dT_e}{d\tau_n} = \sqrt{T_e/T_0} [a_n T_0 - (T_e - T)], \quad (22)$$

$$\frac{dT}{d\tau_n} = \sqrt{T_e/T_0} (T_e - T), \quad (23)$$

где τ_n — безразмерное время,

$$\tau_n = \nu_{en}(0)t, \quad (24)$$

$\nu_{en}(0)$ — частота релаксации температуры ν_{en} в начальный момент времени, когда $T_e = T = T_0$, а параметр a_n имеет вид

$$a_n = \frac{3\pi}{16} \frac{M}{2m_e} \left[\frac{u}{v_{T_0}} \right]^2 \ll 1. \quad (25)$$

Вводя переменную Ω_n , согласно соотношению $d\Omega_n/d\tau_n = \sqrt{T_e/T_0}$, из системы уравнений (22) и (23) находим

$$T_e + T = 2T_0(1 + a_n\Omega_n/2), \quad (26)$$

$$T_e - T = 0.5a_nT_0[1 - \exp(-2\Omega_n)]. \quad (27)$$

Тогда, когда $\Omega_n \ll 0.5$, из (26) и (27) получаем $T_e \sim T_0(1 + \Omega_n a_n)$, $T \sim T_0$. Из этих соотношений и определения Ω_n видим, что при $\Omega_n \ll 0.5$ имеет место связь $\Omega_n \sim \tau_n$. Если $\Omega_n \gg 0.5$ или $\tau_n \gg 0.5$, из (27) приближенно имеем

$$T_e - T \approx 0.5a_nT_0. \quad (28)$$

Используя соотношение (28) и условие $T_e(\tau_n \sim 0.5) \sim T_0(1 + 0.5a_n) \sim T_0$ из уравнения (22) для температуры электронов, находим

$$\begin{aligned} T_e &= T_0[\sqrt{1 + 0.5a_n} + a_n(\tau_n - 0.5)/4]^2 \\ &\approx T_0(1 + a_n\tau_n/4)^2. \end{aligned} \quad (29)$$

При этом температура электронов незначительно превышает температуру нейтральных частиц (см. (28)).

Характерное время нагрева частиц в слабоионизованной плазме дается соотношением $\tau_n \sim 4/a_n$ или

$$t_{T_n} = 4\sqrt{\frac{2}{\pi}} \left[\frac{v_{T_0}}{u} \right]^2 \frac{1}{\nu_{en}(0)}, \quad (30)$$

где $\nu_{en}(0) = \nu_{en}(v_{T_0})$.

Полученные выше закономерности эволюции температуры электронов (см. (15) и (29)) позволяют описать влияние нагрева электронов на проникновение пробного импульса.

2. Воздействие пробного импульса

Примем, что на плазму перпендикулярно ее границе падает электромагнитный импульс вида

$$\begin{aligned} E_y^{(i)}(x, t) &= E_{py}[\eta(t - x/c - \Delta) \\ &\quad - \eta(t - x/c - \Delta - t_p)], \quad x < 0, \end{aligned} \quad (31)$$

где $\eta(\xi) = 0$ при $\xi < 0$ и $\eta(\xi) = 1$ при $\xi > 0$, c — скорость света, Δ — время задержки, которое введено для разнесения во времени начала эволюции основного состояния плазмы и начала воздействия электромагнитного импульса, t_p — длительность импульса. Электромагнитный импульс частично отражается от плазмы. Внутри плазмы импульс создает возмущение напряженности электрического поля δE_y , которое перпендикулярно основному полю E . В линейном приближении по δE_y возмущения поля δE_y не приводят к возмущению температур частиц $\delta T_e = \delta T_i = \delta T = 0$. Для определения δE_y используем уравнение

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \delta E_y = \frac{4\pi}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} (\sigma \delta E_y), \quad (32)$$

в которое входит невозмущенная проводимость плазмы $\sigma = j/E$. Локальная связь плотности тока с напряженностью поля имеет место в условиях нормального скин-эффекта. В связи с этим основанное на уравнении (32) описание воздействия пробного импульса на плазму оправдано, если его длительность много больше времени свободного пробега электронов, а длина свободного пробега электронов меньше характерного пространственного масштаба изменения поля. При написании уравнения (32) отброшен ток смещения, который пренебрежимо мал в условиях, когда $4\pi\sigma t_E \gg 1$, где t_E — характерное время изменения поля. Уравнение (32) следует дополнить начальными и граничными условиями. В момент $t = 0$ считаем, что $\delta E_y(x, t = 0) = 0$, $x > 0$. Достаточно далеко от границы плазмы имеем условие

$$\delta E_y(x \rightarrow \infty, t) = 0. \quad (33)$$

В свою очередь, из условий непрерывности тангенциальных компонент поля на границе плазмы имеем

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - c \frac{\partial}{\partial x} \right) \delta E_y(x, t)|_{x=0} = 2 \frac{\partial}{\partial t} E_y^{(i)}(x = 0, t). \quad (34)$$

Тогда, когда мал ток смещения, принимая во внимание явный вид импульса (31) из (34), имеем

$$\frac{\partial}{\partial x} \delta E_y(x, t)|_{x=0} = -\frac{2}{c} E_{py} \{ \delta(t - \Delta) - \delta(t - \Delta - t_p) \}. \quad (35)$$

С целью решения уравнения (32) перейдем к новой функции w и новой независимой переменной τ , которые определяются соотношениями:

$$w = w(x, \tau) = \sigma[t(\tau)] \delta E_y[x, t(\tau)], \quad (36)$$

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{1}{4\pi\sigma(t)}, \quad \tau(t=0) = 0. \quad (37)$$

При этом для определения функции $w(x, \tau)$ имеем уравнение

$$\frac{\partial}{\partial \tau} w(x, \tau) = c^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} w(x, \tau), \quad (38)$$

граничные условия

$$w(x \rightarrow \infty, \tau) = 0, \quad (39)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} w(x, \tau)|_{x=0} = & -\frac{2}{c} \sigma[t(\tau)] E_{py} \{ \delta[t(\tau) - \Delta] \\ & - \delta[t(\tau) - \Delta - t_p] \} \equiv \Psi(\tau) \end{aligned} \quad (40)$$

и начальное условие $w(x > 0, \tau = 0) = 0$. Отвечающее таким условиям решение уравнения (38) имеет вид

$$w(x, \tau) = -\frac{c}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\tau} \frac{d\tau' \Psi(\tau')}{\sqrt{\tau - \tau'}} \exp\left[-\frac{x^2}{4c^2(\tau - \tau')}\right], \quad (41)$$

что позволяет записать следующее выражение для возмущения поля в плазме:

$$\begin{aligned} \delta E_y(x, t) = & \frac{E_{py}}{2\pi\sqrt{\pi}\sigma(t)} \\ & \times \left\{ \frac{\eta(t - \Delta)}{\sqrt{\tau(t) - \tau(\Delta)}} \exp\left[-\frac{x^2}{4c^2(\tau(t) - \tau(\Delta))}\right] \right. \\ & \left. - \frac{\eta(t - \Delta - t_p)}{\sqrt{\tau(t) - \tau(\Delta + t_p)}} \exp\left[-\frac{x^2}{4c^2(\tau(t) - \tau(\Delta + t_p))}\right] \right\}. \end{aligned} \quad (42)$$

Согласно (42), проникновение поля ступенчатого импульса в глубь плазмы можно представить как распространение двух фронтов — „включения“ и „выключения“. Фронт „включения“ описывает первое слагаемое в (42), а фронт „выключения“ — второе. Второй фронт смещен по отношению к первому на длительность импульса t_p . В тех точках, куда пришел второй фронт, происходит частичная компенсация поля. Характерная глубина проникновения поля в плазму определяется первым слагаемым в (42) и дается соотношением

$$x \propto 2c\sqrt{\tau(t) - \tau(\Delta)}. \quad (43)$$

Если проводимость плазмы не изменяется со временем, то, согласно (37), $\tau \propto t$ и проникновение поля в глубь плазмы происходит в соответствии со скейлингом (43), отвечающим обычной диффузии $x \propto \sqrt{t}$. Формулы (37) и (43) позволяют качественно описать проникновение поля в нестационарную среду, когда ее проводимость изменяется со временем из-за нагрева. Если нагрев среды приводит к росту проводимости, то, согласно (37), с течением времени скорость роста τ уменьшается, т.е. τ растет медленнее, чем t . При этом из соотношения (43) следует, что глубина проникновения растет медленнее, чем \sqrt{t} . В этом случае можно говорить о субдиффузии поля. Напротив, если нагрев приводит к уменьшению проводимости, то реализуется рост τ более быстрый, чем t . В этих условиях имеет место сверхдиффузия, т.е. более быстрое проникновение поля по сравнению с обычной диффузией.

3. Влияние нагрева частиц на проникновение поля

Для получения количественных закономерностей проникновения поля пробного импульса в греющуюся плазму достаточно найти явную связь $\tau(t)$ со временем t . Эта связь зависит от вида проводимости $\sigma(t)$, которая отличается в полностью ионизованной и слабоионизованной плазмах.

3.1. Полностью ионизованная плазма

В случае полностью ионизованной плазмы имеем $\sigma(t) \propto [T_e(t)/T_0]^{3/2}$. При этом зависимость температуры электронов от времени дается приближенным соотношением (15). Используя соотношение (15), из уравнения (37) находим, что определяющая глубину проникновения поля (43) разность $\tau(t) - \tau(\Delta)$ имеет вид

$$\begin{aligned} \tau(t) - \tau(\Delta) = & \frac{15\pi}{64} \frac{v_{ei}(0)t_T}{\omega_{Le}^2} \\ & \times [(1 + t/t_T)^{2/5} - (1 + \Delta/t_T)^{2/5}], \quad t > \Delta. \end{aligned} \quad (44)$$

На временах, удовлетворяющих неравенству (17) и при $\Delta > t_T$, единицами в круглых скобках формулы (44) можно пренебречь. При этом в соответствии с соотношением (43) в условиях нагрева частиц плазмы для характерной глубины проникновения поля в плазму находим

$$x \propto \frac{\sqrt{15\pi}}{4} \frac{c}{\omega_{Le}} \sqrt{v_{ei}(0)t} \left(\frac{t_T}{t}\right)^{3/10} \sqrt{1 - (\Delta/t)^{2/5}}. \quad (45)$$

Из (45) видно, что нагрев плазмы приводит к относительно замедлению проникновения пробного поля в плазму.

3.2. Слабоионизованная плазма

В слабоионизованной плазме температура электронов описывается выражением (29), которое позволяет видеть, как изменяется проводимость $\sigma(t) \propto \sqrt{T_0/T_e(t)}$. Используя результат (29) из уравнения (37), для разности $\tau(t) - \tau(\Delta)$ получаем

$$\tau(t) - \tau(\Delta) = \frac{3\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} \frac{v_{en}(0)(t - \Delta)}{\omega_{Le}^2} \left[1 + \frac{t + \Delta}{2t_{Tn}} \right], \quad t > \Delta. \quad (46)$$

На стадии нагрева, когда $t + \Delta \gg 2t_{Tn}$, из (46) и (43) получаем зависимость от времени глубины проникновения поля в виде

$$x \propto (3\sqrt{\pi/2})^{1/2} \frac{c}{\omega_{Le}} \sqrt{v_{en}(0)t} \left(\frac{t}{t_{Tn}} \right)^{1/2} \sqrt{1 - (\Delta/t)^2}. \quad (47)$$

В этом случае нагрев плазмы приводит к более быстрому проникновению поля, чем в случае обычной диффузии.

Заключение

Во время воздействия короткого импульса, когда плазму можно считать стационарной средой, проникновение поля происходит по обычному диффузионному закону \sqrt{t} . Учет нагрева плазмы за время действия длинного импульса приводит к изменению закономерностей проникновения поля пробного импульса. В случае полностью ионизованной плазмы, когда доминируют парные электрон-ионные столкновения, проникновение поля происходит в режиме субдиффузии. Если же преобладают упругие столкновения электронов с нейтральными частицами, что имеет место в слабоионизованной плазме, то реализуется сверхдиффузия поля.

В [10] приведены экспериментальные данные, полученные на установке ТУМАН-3, среди которых есть такие, когда токовая скорость электронов сравнима или меньше скорости ионного звука. В этой же работе сопоставлены экспериментальные данные для токамаков с существенно отличающимися размерами и концентрациями плазмы. При этом отмечается, что часть разрядов на проанализированных установках находится в „дозвуковом“ режиме. Дозвуковой режим создавался увеличением плотности числа частиц путем инжекции пеллет (Alcator, ASDEX) либо газонапуска (ASDEX, TFTR). В [10] приведена связь тока и концентрации плазмы на установке DITE для разрядов в дейтерии и водороде. Отмечено, что в обоих случаях получение максимальной концентрации соответствовало фазе с уменьшающимся током и в этой же фазе происходил переход в „дозвуковой“ режим. Изложенная выше теория может быть использована для анализа проникновения электромагнитного импульса в „дозвуковые“ разряды на указанных установках, если длительность импульса превышает характерное время нагрева частиц плазмы.

Для оценок используем следующий набор параметров: $n_e \sim 6 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$, $T_e \sim 50 \text{ eV}$, $I \sim 100 \text{ kA}$ и радиус шнура плазмы $r \sim 15 \text{ cm}$. При таких значениях параметров токовая скорость электронов меньше скорости ионного звука. При этом длина свободного пробега электронов сравнима с x_T , и для оценок можно использовать соотношения, полученные в предположении о нормальном скин-эффекте. В этих условиях для характерного времени нагрева частиц плазмы и характерного пространственного масштаба $x_T = (15\pi v_{ei}(0)t_T/16)^{1/2} c/\omega_{Le}$ получаем оценки $t_T \sim 0.3 \text{ ms}$, $x_T \sim 5 \text{ cm}$. Т.е. представленная теория необходима, если длительность воздействующего импульса превышает 0.3 ms.

В качестве физического объекта для иллюстрации проникновения электромагнитного импульса в слабоионизованную плазму рассмотрим разряд молнии. В разряде молнии величина тока, плотность и температура электронов могут меняться в очень широких пределах. Для оценки примем $n_e \sim 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $T_e \sim 1 \text{ eV}$. Радиус канала молнии оценим как $r \sim 10 \text{ cm}$ ([12], стр. 134–135), а величину тока как $I \sim 100 \text{ kA}$ ([12], стр. 122). Для оценки также примем $\Sigma \sim 10^{-15} \text{ cm}^2$ и $N \sim 3 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$. При таких параметрах для времени нагрева электронов и пространственного масштаба $x_{Tn} = (3\sqrt{\pi/2}v_{en}(0)t_{Tn})^{1/2} c/\omega_{Le}$ получаем оценки $t_{Tn} \sim 0.1 \mu\text{s}$, $x_{Tn} \sim 2 \text{ cm}$.

Список литературы

- [1] Wharton C.B., Horn P., Robertson S. // Phys. Rev. Lett. 1971. Vol. 27. N 8. P. 499–501.
- [2] Nishida Y., Hirose A., Skarsgard H.M. // Phys. Rev. Lett. 1977. Vol. 38. N 12. P. 653–656.
- [3] Hirose A., Kawabe T., Skarsgard H.M. // Phys. Rev. Lett. 1972. Vol. 29. N 21. P. 1432–1434.
- [4] Vyshenkov V.Yu., Frank P., Eimmel G. et al. // Phys. Lett. A. 1992. Vol. 169. N 1, 2. P. 77–81.
- [5] Быченков В.Ю., Новиков В.Н. // Физика плазмы. 1994. Т. 20. Вып. 5. С. 513–516.
- [6] Овчинников К.Н., Урюпин С.А. // ЖТФ. 2009. Т. 79. Вып. 7. С. 59–62.
- [7] Овчинников К.Н., Силин В.П., Урюпин С.А. // Физика плазмы. 2009. Т. 35. Вып. 12. С. 1118–1125.
- [8] Овчинников К.Н., Силин В.П., Урюпин С.А. // ЖТФ. 1989. Т. 59. Вып. 9. С. 29–36.
- [9] Овчинников К.Н., Урюпин С.А. // Физика плазмы. 2013. Т. 39. Вып. 9. С. 837–847.
- [10] Виноградов Н.И., Извозчиков А.В., Шаховец К.Г. // Препринт ФТИ им. А.Ф. Иоффе № 1177. 1987.
- [11] Гинзбург В.Л., Гуревич А.В. // УФН. 1960. Т. LXX. Вып. 2. С. 201–246.
- [12] Базелян Э.М., Райзер Ю.П. Физика молнии и молниезащиты. М.: Физматлит, 2001. 320 с.